



[首页](#) | [研究所概况](#) | [师资队伍](#) | [人才培养](#) | [学科建设](#) | [科学研究](#) | [招生就业](#) | [现有设备](#) | [下载中心](#)

站内搜索

-选择类别-

搜索

站内搜索

当前位置 >> [首页](#) >> [师资队伍](#) >> [杨吉军](#)

## 杨吉军

作者: 发表时间: 2012-03-20 浏览次数: 249次

1979年6月生，博士，副研究员，硕士生导师。2001年毕业于西安交通大学材料科学与工程专业，随后继续在西安交通大学攻读硕士和博士学位，分别于2004和2008年获西安交通大学材料专业硕士和博士学位。2008年11月博士毕业后到四川大学原子核科学技术研究所从事科研与教学工作，2010年入选四川大学“青年骨干教师奖励计划”。

长期从事薄膜材料制备与结构性能研究，尤以薄膜表面形貌表征及其与结构、性能的相关性为主要研究方向，近年来倾向于核能应用新型功能材料的研究方向。已作为负责人承担国家自然科学基金1项，横向协作课题2项，并参与了多项国家自然科学基金、973子项目和ITER项目等课题的研究工作。在*Appl Phys Lett*、*J Appl Phys*、*Surf Coat Tech*等国外知名期刊上发表研究论文近20篇，其中SCI收录10余篇，获准国家发明专利4项。

主要研究领域:

1. 薄膜材料制备与结构性能研究
2. 新型功能材料的可控制备、表征及其在核能中的应用

代表性论文或成果:

1. Homologous temperature dependence of global surface scaling behaviors of polycrystalline copper films. *Appl Phys Lett*, 2009, 95(19): 194104(1-3).
2. Ultrathin CuSiN/p-SiC:H bilayer capping barrier for Cu/ultralow-k dielectric integration. *Appl Phys Lett*, 2009, 94(15): 153116(1-3).
3. Characterization of multiscale surface evolution of polycrystalline copper thin films. *J Appl Phys*, 2007, 101(10): 104902(1-7).
4. Effect of substrate on surface morphology evolution of Cu thin films deposited by magnetron sputtering. *Surf & Coat Tech*, 2007, 201(9-11): 5574-5577.
5. Kinetic Surface Roughening of TaN Thin Films Sputtered at Different N<sub>2</sub>/Ar Flow Ratios. *Proc IEEE*, 2010, 823-924.

电 话: 028-85412613

E-Mail: [jjyang@scu.edu.cn](mailto:jjyang@scu.edu.cn)

打印本页

结束浏览

[研究所概况](#) | [招生就业](#) | [下载中心](#)